| 中文摘要i |
|--|
| 英文摘要iii |
| 誌謝v |
| 目錄vi |
| 圖目錄viii |
| 表目錄xiii |
| Chapter 1 緒論1 |
| Chapter 2: 量子尖端接觸與量子點系統的特性3 |
| 2.1 GaAs/AlGaAs 二維電子氣系統 |
| 2.2 量子尖端接觸(quantum point contact)與量子化電導 |
| 2.3 量子點系統 |
| 2.3.1 開放式量子點系統11 |
| 2.3.2 封閉式量子點系統 |
| Chapter 3: 元件製作與量測系統介紹18 |
| 3.1 元件製作 |
| 3.1.1 光微影技術18 |
| 3.1.2 電子束微影技術(electron-beam lithography process) |
| 3.2 量測系統介紹 |
| 3.2.1 低溫系統 |
| 3.2.2 兩點與四點電阻量測 |
| 3.2.3 漏電流測量(leakage current measurement) |
| 3.2.4 電性量測 |
| Chapter 4: 實驗數據分析與討論 |
| 4.1 樣品特徵值 |

| 4.2 量子尖端接觸之電性傳輸 | 42 |
|---------------------|----|
| 4.2.1 單一量子尖端接觸的電性傳輸 | 42 |
| 4.2.2 串聯量子尖端接觸的電性傳輸 | 45 |
| 4.3 量子點之電性傳輸 | 48 |
| 4.3.1 封閉式量子點之電性傳輸 | 48 |
| 4.3.2 量子點之數據分析與討論 | 54 |
| Chapter 5:結論與未來展望 | 61 |
| 參考文獻 | 62 |



圖目錄

| 圖 2.1 | 二維電子氣系統的結構圖與能帶圖。3 |
|-------|---|
| 圖 2.2 | 量子尖端接觸(QPC)示意圖:在一對分離閘極上加負偏壓,使閘極下的電 |
| | 子被閘極產生的電場驅離(虛線部分),形成量子尖端接觸(圖中的窄通 |
| | 道)。元件的長度定義為L,寬度定義為W。5 |
| 圖 2.3 | 分離閘極外加電壓之位能圖。(a)L=200nm,W=300nm之金屬閘極與電場 |
| | 分佈圖之俯視圖。(b) L=600nm, W=300nm 之金屬閘極與電場分佈圖之俯 |
| | 視圖。(c) L=200nm, W=300nm 之金屬閘極的電場分佈立體圖。(d) |
| | L=200nm,W=300nm之金屬閘極的電場分佈立體圖。6 |
| 圖 2.4 | 在窄通道內 k_x 對 E_n 的關係圖,外加的電壓 V_{SD} 使兩邊的化學能不一致, |
| | $eV_{sD} = \mu_s - \mu_D$ 。電子可佔據的次能階為費米能量以下, $\mu_s 與 \mu_D$ 之間的能 |
| | 階。 |
| 圖 2.5 | 電導與閘極偏壓之關係圖。圖中平坦的部分即為量子化平台(plateaus),電 |
| | 導值為2e ² /h的整數倍。 |
| 圖 2.6 | 金屬閘極在掃描式電子顯微鏡下的影像,白色部分為金屬閘極,分別標示 |
| | 為1-6°深色部分為2DEG的表面。9 |
| 圖 2.7 | 7 量子點內電荷與閘極電壓之關係。(a)量子點與兩邊通道的示意圖。(b)古 |
| | 典敘述的金屬點可視為一電容,與閘極電壓為線性關係, $Q = C_g V_g \circ (c)$ |
| | 在量子點內,隨著閘極電壓增加,在某些特定電壓下電荷逐一的增加,形 |
| | 成階梯狀關係。(d)當量子點內的電荷進出時,對應的電流對閘極電壓關 |
| | 係,稱為庫侖阻絕(Coulomb Blockade)。10 |
| 圖 2.8 | 電子通過量子點的任兩種可能路徑,因為行走的路徑不同而有相位差,形 |
| | 成量子干涉。電導值決定於所有通過量子點的電子波函數之量子干涉結 |
| | 果。11 |
| 圖 2.9 |) A. Huibers(Marcus Group)在一開放式量子點系統的電導震盪(Universal |

| Conductance Fluctuations, UCF)。(a)改變閘極電壓。(b)改變垂直磁場。12 |
|---|
| 圖 2.10 開放式量子點的電導值對垂直磁場之關係。13 |
| 圖 2.11 封閉式量子點與源極、汲極、閘極之間的電路示意圖。13 |
| 圖 2.12 庫侖阻絕震盪的能階圖。(a)量子點內第 N+1 個能階沒有對到源極與汲極 |
| 的化學能之間 $(eV_{sd} = \mu_s - \mu_d)$,電子無法以穿遂的方式進入到量子點內。 |
| (b)藉由控制閘極電壓 Vg,改變量子點內的位能,使第 N+1 個能階對準到 |
| 源極與汲極的化學能之間,電子以穿遂的方式進出量子點。(c)通過量子 |
| 點的電導對閘極電壓之曲線圖, $	riangle V_{g}$ 為相鄰兩個電導峰值之間的電壓差 |
| (peak spacing) •15 |
| 圖 2.13 庫侖阻絕震盪(Coulomb Blockade Oscillation, CB Oscillation)電導對閘極 |
| 電壓 Vg 的關係圖。16 |
| 圖 2.14 Coulomb Blockade peak 對溫度的關係圖。在 0.1K 的溫度下 |
| $(\Gamma < kT < \Delta < U)$,CB peak 的高度與量子點和源極、汲極通道的耦合強度有 |
| 關。溫度增加後((Γ,Δ)< <i>kT</i> <u), cb="" peak="" td="" 的寬<="" 的高度相差不多。cb=""></u),> |
| 度也隨著溫度的增加而有變寬的趨勢。17 |
| 圖 3.1 光學顯微鏡下的平台結構。A 部分為平台結構(MESA), B 部分為接點平 |
| 台(ohmic contact), C部分為金屬閘極平台(gate)。18 |
| 圖 3.2 光學顯微鏡下的金屬閘極。 |
| 圖3.3 蒸鍍系統前視簡圖。 |
| 圖 3.4 金屬閘極在掃描式電子顯微鏡下的影像,參數設定均為 center-to-center |
| distance:19.49nm,line spacing:50.67nm。(a)量子點面積 1.0×0.45µm ² 。 |
| (b)量子點面積 1.0×0.6μm ² 。 |
| 圖 3.5 金屬閘極在掃描式電子顯微鏡下的影像,參數設定均為 center-to-center |
| distance:19.49nm,line spacing:19.49nm。(a)量子點面積 1.0×0.45µm ² 。 |
| (b)量子點面積 1.0×0.6μm ² 。 |
| 圖 3.6 金屬閘極在掃描式電子顯微鏡下的影像,每個圖形的局域區域的長寬分別 |

| 為:(a) 量子點面積 1.36×1.7μm ² ,(b) 量子點面積 1.65×0.8μm ² ,(c) 量子 |
|--|
| 點面積 1.0×0.45µm ² , (d) 量子點面積 1.0×0.6µm ² , (e)量子點面積 |
| $1.0 \times 0.45 \mu m^2 \circ \cdots 27$ |
| 圖 3.7 為 ³ He cryostat system 的工作簡圖。左邊是 ³ He 在向下凝結(condense)於 ³ He |
| pot 的情形。右邊的圖是將 sorb 溫度降低後, ³ He 開始蒸發向上,離開 ³ He |
| pot,如此樣品座的溫度可降到 0.3K。 |
| 圖 3.8 (a)兩點(two terminal)量測電路圖, (b)四點(four terminal)量測電路圖。Rs |
| 代表黃色區域的電阻值。 |
| 圖 3.9 (a)測量漏電流電路,金屬閘極加正偏壓。(b)測量漏電流電路,金屬閘極加 |
| 負偏壓。 |
| 圖 3.10 定電流源四點量測電路圖。 |
| 圖 3.11 定電壓源量測電路的簡圖。 |
| 圖 3.12 抽運閘種(pumping gate)的標示圖。圖(a)和(b)分別為不同幾何形狀的量子 |
| 點結構。 |
| 圖 3.13 (a)在樣品座插上金屬線連接起來,測量交流訊號經過整個低溫系統的 |
| 衰減值。(b)在樣品座焊接上金屬線連接起來,測量交流訊號經過整個 |
| 低溫系統的衰減值。低溫系統內的同軸電纜線的長度約為3米。36 |
| 圖 3.14 E8257C 訊號產生器的輸出頻率對頻譜分析儀所測量的訊號衰減值之關 |
| 係圖。 Y 軸為 spectrum analyzer 所測量的數據(圖中方形符號曲線為表 |
| 3.1 的數據,圓形符號曲線為表 3.2 的數據),單位為 dBm。 |
| 圖 4.1 樣品上製作的 Hall bar 結構。 |
| 圖 4.2 二維電子氣系統(樣品編號 5-70)中縱向電阻(pxx)與橫向(pyx)電阻率對磁場 |
| 變化的關係圖,量測溫度為 0.3K。可看到橫向電阻的量子平台出現的磁 |
| 場位置與縱向電阻的曲線波谷相對應。40 |
| 圖 4.3 利用掃瞄式電子顯微鏡拍攝在平台結構上的量子點元件。左邊為 dot-U, |
| 右邊為 dot-D, 元件的量子尖端接觸的寬度分別為 0.4μm 與 0.37μm。42 |

х

圖 4.4 金屬閘極在掃瞄式電子顯微鏡下放大的圖形,可以 U1U2U3U4U5 加負偏 壓造成電位牆,使下層的二維電子氣影響。U5 與 U1、U4 分別間距 0.4µm, 圖 4.5 通過 QPC 的電阻對外加負偏壓(Vg)的關係圖。左邊黑色曲線為 QPC1 對 V₂的關係圖,右邊紅色曲線為QPC2對V₂的關係圖。圖中可看到當V₂ 約-0.2V,電阻開始增加,表示 Vg開始影響底下的 2DEG,使閘極下的電 子被排開,電子由二維轉換為一維通道的現象。......44 圖 4.6 通過 QPC 的電導對外加負偏壓(V_a)的關係圖。左邊黑色曲線為 QPC1 對 Vg的關係圖,右邊紅色曲線為QPC2對Vg的關係圖。在圖中QPC1可以 看到約7個清晰的量子化平台(plateau),在QPC2可看到約5個清晰的量 子化平台(均已扣除起始電阻值)。......44 圖 4.7 金屬閘極在掃瞄式電子顯微鏡下放大的圖形,量子點結構大小為 45 1.0μm×0.6μm ° 圖 4.8 通過 QPC 的電導對外加負偏壓(Vg)的關係圖,分別各做兩次測量觀察其重 圖 4.9 固定 QPC1 的電導值後,改變外加在 g4 的負偏壓,測量電導對負偏壓(V。) 的關係圖。我們固定 QPC1 的電導值分別為(2e²/h)xn,n=2、1、0.6。............46 圖 4.10 固定進出口端 QPC1 與 QPC2 的寬度後(固定 U1、U4、U5 的電壓), 電 導對外加偏壓於 U2U3 的關係圖。初始電阻分別設定在 $100k\Omega$ 、 $200 k\Omega$ 與 500 kΩ,可看到外加偏壓約-0.05V 之後的電導值開始減小,表示閘極 產生的電場開始深入二維電子氣,使閘極下的電子被排開而開始形成量 子點系統。通過封閉式量子點系統的電導值約在 0.0002x(2e²/h)~ 0.0010 圖 4.11 通過兩個 OPC 的初始電阻設定為 $100k\Omega$ 的電導-電壓關係圖(G-V curve)。 我們將 U1U4U5 外加一固定負偏壓,使兩個 QPC 的電導值均小於(2e²/h),

再在 U2U3 閘極上外加偏壓,測量通過量子點系統的電導-電壓關係圖。

| 圖中可以看到改變 U2U3 的外加偏壓,電導產生振盪現象,另一組無劇烈 |
|--|
| 震盪曲線。而穩定量子點的電導值是 U2U3 外加偏壓固定下的電導對時間 |
| 關係圖。 |
| 圖 4.12 通過兩個 QPC 的初始電阻設定為 200kΩ的電導-電壓關係圖。52 |
| 圖 4.13 通過兩個 QPC 的初始電阻設定為 500kΩ的電導-電壓關係圖。52 |
| 圖 4.14 固定 U1U4U5 與 U2 的偏壓,改變 U3 偏壓,測量的電導對閘極偏壓的關 |
| 係圖。 |
| 圖 4.15 S. R. Patel (Marcus group)在二維電子氣上製作的量子點結構。(a)量子點 |
| 結構在 SEM 下的影像,量子點面積約 0.47µm ² 。(b)測量到的 Coulomb |
| Blockade Oscillation, 其中峰值間距(△Vg)約6meV的大小。55 |
| 圖 4.16 溫度對 Coulomb Blockade Oscillation 的影響。測量溫度分別為(a)45mK |
| ₹¤(b)400mK ∘ |
| 圖4.17 S. R. Patel所製作的量子點結構在SEM下的影像。(a)Dot 6,量子點面積為 |
| 0.47μm ² 。(b) Dot 4,量子點面積為0.34μm ² 。59 |
| Thomas and the second second |
| |

表目錄

| 表 3.1 | 頻譜分析儀測量圖 3.13(a)電路的訊號衰減值。在 50Ω匹配的系統內, Source |
|-------|---|
| | 端輸出(-10dBm)相對於電壓 Vrms約0.071volt。37 |
| 表 3.2 | 頻譜分析儀測量圖 3.13(b)電路的訊號衰減值。 |
| 表 4.1 | Umansky 團隊所提供的二維電子氣樣品(樣品編號 5-70, 5-90)的樣品特徵 |
| | 值。41 |
| 表4.2 | 不同的量子點面積大小所對應的特性參數。表中的參數依序為:量子點 |
| | 面積(A), 2DEG的深度(d), level spacing($\Delta = \frac{\hbar^2 \pi}{m^* A}$), charging energy |
| | $(E_c = \frac{e^2}{C_{dot}})$ 與量子點內的電子數目(N)。 |

